## ドリフト拡散シミュレーションによる BaSi<sub>2</sub>太陽電池の構造最適化 Device Structure Optimization of BaSi<sub>2</sub> solar cells via Drift-Diffusion Simulations 東芝マテリアル(株)<sup>1</sup>,東京工科大工<sup>2</sup>,筑波大電物<sup>3</sup>,<sup>0</sup>佐々木 敦也<sup>1</sup>,佐々木 亮人<sup>1</sup>, 片岡 好則<sup>1</sup>,佐藤 光<sup>1</sup>,平林 英明<sup>1</sup>,齋藤 秀一<sup>1</sup>,小林 薫平<sup>1</sup>,高木 茂行<sup>2</sup>,佐野 伸行<sup>3</sup> Toshiba Materials Co.,LTD.<sup>1</sup>, Tokyo Univ. of Tech.<sup>2</sup>, Univ. of Tsukuba<sup>3</sup>,<sup>0</sup>Atsuya Sasaki<sup>1</sup>, Akito Sasaki<sup>1</sup>, Yoshinori Kataoka<sup>1</sup>, Akira Sato<sup>1</sup>, Hideaki Hirabayashi<sup>1</sup>, Shuichi Saito<sup>1</sup>, Kumpei Kobayashi<sup>1</sup>, Shigeyuki Takagi<sup>2</sup>, Nobuyuki Sano<sup>3</sup>

## E-mail: atsuya.sasaki@toshiba.co.jp

[背景と目的] BaSi<sub>2</sub>は太陽電池に適した禁制帯幅(*E*g=1.3eV)を持つ。また Si の 100 倍以上の光 吸収係数を有するので、高効率薄膜太陽電池として期待される。しかし実用化には多くの課題が あり、再結合等を考慮したデバイス特性予測、構造最適化が求められる。そこで、BaSi<sub>2</sub>材料に適 用可能な pn-Si ダイオード構造でのドリフト拡散シミュレータを構築し、pn-BaSi<sub>2</sub>太陽電池の膜厚 やキャリア密度 *N*s の最適化を検討した。

[シミュレータの妥当性の確認] BaSi<sub>2</sub>の物性値は、実験[1]や理論[2]の文献の値を用いた。光 照射はAM1.5 スペクトルをフィッティングして取入れた。構築したシミュレータの妥当性確認の ため、pn-BaSi<sub>2</sub>の理論最大効率を計算した。膜厚は光吸収に十分な 2 $\mu$ m、N<sub>s</sub>は拡散電位と禁制帯 幅 1.3eV が等価になる値、再結合は放射再結合のみ考慮(Si の値を代用)した。図1に計算結果を示 す。短絡電流  $J_{sc}$ =36.2mA/cm<sup>2</sup>、開放電圧  $V_{oc}$ =0.99V、F値 FF=0.89 となり、文献[3]に示される  $E_{g}$ =1.3eV のホモ型太陽電池の理論最大値( $J_{sc}$ =36mA/cm<sup>2</sup>、 $V_{oc}$ =1.0V、FF=0.88)と良い一致が得られた。

[計算結果・考察] 構築したシミュレータを用いて、表面再結合速度が支配的な条件のもとで、 pn-BaSi<sub>2</sub>(2µm)における、短絡電流のキャリア密度(N<sub>s</sub>)依存性を計算した。放射再結合とオージェ再 結合は結晶 Si の値を代用した。また積層構造は、より高効率が得られるように薄膜化した n 型を 上部層をとする n 層(50nm)/p 層(1950nm)薄膜構造を仮定した。図 2(a)に短絡電流 J<sub>sc</sub>の N<sub>s</sub>依存性、 図 2(b)に上部 n 層空乏層幅 W の N<sub>s</sub> 依存性を示す。図 2(a),(b)ともに N<sub>s</sub>(上部 n 層) < N<sub>s</sub>(下部 p 層) とすると、J<sub>sc</sub>および W の強い正の相関が得られた。これより、短絡電流増大には、上部 n 層側で の空乏層幅の拡大が特性に重要であると明らかになった。光吸収係数が大きい pn-BaSi<sub>2</sub> は、表面 再結合による影響が大きく、表層側に空乏層を拡げることで電流損失を抑制できる可能性が示唆 される。





Fig.1: Theoretical maximum efficiency of pn-BaSi<sub>2</sub> solar cell. Calculation structure:  $(0.5\mu m n-layer)/(1.5\mu m p-layer)$ 

Fig.2 : Calculation of (a) $J_{sc}$  and (b)W depending on carrier density ( $N_s$ ) for pn-BaSi<sub>2</sub> solar cell. Metal (ohmic) contact is set as the surface boundary condition for the surface recombination rate to be dominant.

[参考文献] [1] K. Morita, Y. Inomata, and T. Suemasu, Thin Solid Films **508**, (2006) 363. [2] D. B. Migas, V. L. Shaposhnikov, and V. E. Borisenko, phys. stat. sol. (b) **244**, No.7 (2007). [3] F. H. Alhabi, S. N. Rashkeev, F. El-Mellouhi, *et al.*, npj. Computational Materials **1**, (2015) 15003.